

高真空蒸着装置 ED-1700R



高真空蒸着装置ED-1700Rは電子銃(JEOL製 JEBG-303UA)による将来はマルチコートを目的とした装置であり、トリプルソースコントローラにて成膜することが出来ます。排気系はオイルフリー、または通常での排気も出来る様にドライポンプ、油回転ポンプの切替も可能となっています。

高真空蒸着装置ED-1700R仕様

- 到達圧力 ×10⁻⁴Pa以下※常温・無負荷・脱ガス時
- 真空室径 φ700mm×800mmH SUS304 電解研磨
- 蒸着機構 電子銃電源:JST-10F(JEOL製)
電子銃ルツボ:JEBG-303UA(JEOL製)
ルツボ:EBG-30T3Bトリプルハース
φ34mm×20mm×3点(※固定式)
- 基板加熱 ハロゲンランプ1.5KW×2式
常温～400℃迄昇温可能
制御方式:サイリスタ制御・PID方式デジタル温調計
- 膜厚計 水晶振動式膜厚計
- 真空排気系 ドライポンプ:1000L/min[50Hz]
ターボ分子ポンプ:1490L/sec
油回転ポンプ:1340L/min[50Hz]
- 真空計 大気圧検知器/ピラニ真空計/電離真空計
- 制御系 ターボ分子ポンプコントローラ
- 操作方法 手動
- ガス機構 マスフローコントローラ×2式
- ユーティリティ電気:AC200V三相15KVA
冷却水:30L/min以上0.2MPa以上0.25MPa以下25℃以下循環
計装エア:0.5MPa以上
設置寸法:2200mmW×1600mmD×2100mmH
- オプション 基板回転機構